

УДК 537.622.3 + 541.183.56

© 1996 г. А.М. Знатдинов, Н.М. Мищенко

**ФОРМА ЛИНИИ ЭПР, КИНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОНОВ ПРОВОДИМОСТИ И ИХ ИЗМЕНЕНИЕ ПРИ ДВУМЕРНОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ВКЛЮЧЕННЫХ МОЛЕКУЛ В ИНТЕРКАЛИРОВАННЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ГРАФИТА**

Экспериментально обоснована применимость одномерных выражений Дайсона для формы линии ЭПР электронов проводимости (ЭП) в изотропных металлах для анализа формы линии ЭПР ЭП пластинок квазидвумерного сильно-анизотропного проводника интеркалированного соединения графита (ИСГ)  $C_{20}HNO_3$ . Из ЭПР-данных определены значения некоторых кинетических параметров носителей спина и проводимости вдоль оси *c* до и после кристаллизации подсистемы "гостевых" молекул. Установлено, что кристаллизация двумерных слоев интеркалата реализуется двухступенчато и сопровождается уменьшением подвижности носителей спина, увеличением электропроводности и некоторым перераспределением электронной плотности между подсистемами углерода и интеркалата.

#### ВВЕДЕНИЕ

В последние годы метод ЭПР ЭП часто используется при изучении интеркалированных соединений графита (ИСГ), представляющих собой чередующуюся последовательность *n*-гексагональных слоев графита (*n* – так называемый индекс стадии соединения) и слоя "гостевых" молекул (интеркалата) [1–10]. Однако ИСГ являются анизотропными проводниками: в акцепторных и донорных ИСГ отношение проводимости вдоль и перпендикулярно углеродным слоям,  $\sigma_c/\sigma_r$ , соответственно  $\sim 10^5$  и  $\sim 10$  [11]. Поэтому вопрос о применимости к анализу их формы линии ЭПР ЭП известной теории Дайсона [12] и Каплан [13], разработанной для бесконечных изотропных металлических пластинок произвольной толщины с одним типом носителей тока и распространенной Фехером и Кипом [14], Кодера [15] и Пайфером и Магно [16] на пластинки изотропных металлов конечных размеров, до сих пор остается открытым. Отсутствие экспериментально обоснованного метода анализа формы линии ЭПР ЭП сильноанизотропных проводников затрудняет широкое использование этого метода для изучения физико-химических процессов в ИСГ.

В настоящей работе представлены экспериментальные результаты исследований зависимости формы линии ЭПР ЭП пластинок четвертой стадии  $\alpha$ -модификации ИСГ с азотной кислотой,  $C_{5n}HNO_3$  (*n* = 4), от 1) размеров образца, 2) ориентации внешнего постоянного магнитного поля  $H_0$  относительно оси *c* графитовой матрицы, 3) моды микроволнового поля и 4) агрегатного состояния интеркалата (в  $C_{5n}HNO_3$  двумерные жидкокообразные слои  $HNO_3$  при  $T_c = 250$  К кристаллизуются [11, 17]). На основе полученных экспериментальных данных обоснована применимость одномерных выражений Дайсона [12] для анализа формы линии ЭПР ЭП пластинок сильноанизотропного

проводника  $C_{20}HNO_3$ . Из данных ЭПР ЭП определены значения некоторых кинетических параметров носителей спина и  $\sigma_a$ . Выявлено уменьшение при кристаллизации интеркалата подвижности носителей спина вдоль базовой плоскости при одновременном увеличении их концентрации, свидетельствующие о некотором перераспределении электронной плотности между подсистемами графита и интеркалата. Установлено, что кристаллизация решеточной жидкости в исследуемом ИСГ реализуется двухступенчато (через промежуточное состояние).

#### МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Спектры ЭПР ЭП пластинок ИСГ  $C_{20}HNO_3$  записывались на радиоспектрометре ESR-231 (производство Академии наук бывшей ГДР) в  $X$ -диапазоне ( $\nu = 9,52$  ГГц) в прямоугольном резонаторе с модой  $TE_{102}$  при частоте модуляции  $H_0v_m = 2,5$  кГц. При общепринятой установке резонатора вектор электрической компоненты микроволнового поля  $\vec{E}_\eta$  параллелен  $H_0$ ; в геометрической середине резонатора вектор магнитной компоненты микроволнового поля  $\vec{H}_\eta$  параллелен вертикальной оси резонатора, а вектор Пойнтинга  $\vec{P}$  расположен в горизонтальной плоскости и перпендикулярен  $H_0$ . Для выяснения влияния конфигурации силовых линий микроволнового поля на форму линий ЭПР ЭП спектры в  $X$ -диапазоне при 300 К были записаны и в цилиндрическом резонаторе с модой  $H_{011}$ .

Все необходимые для синтеза ИСГ пластинки высокоориентированного ниролитического графита (ВОПГ) были вырезаны из одного бруска, проводимость которого вдоль базовой плоскости была равна  $(1,2 \pm 0,2) \cdot 10^4$  Ом $^{-1} \cdot$  см $^{-1}$  и имели форму прямоугольных параллелепипедов с размерами: ширина ( $l$ )  $\times$  высота ( $h$ )  $\times$  толщина ( $d$ ), где ( $l \times h$ ) – площадь базовой грани. Точность определения размеров пластинок  $= 5 \cdot 10^{-4}$  см.

Синтез ИСГ с  $HNO_3$  четвертой стадии внедрения осуществлялся на двух рядах пластинок ВОПГ: 1) с  $l$ , изменяющимся от 0,032 до 0,315 см при постоянных  $h = 0,505$  см и  $d = 0,018$  см и 2) с  $d$ , изменяющимся от 0,024 до 0,043 см при постоянных  $h = 0,505$  см и  $l = 0,323$  см в азотной кислоте с плотностью  $\rho = 1,492$  г см $^{-3}$ . Стадия ИСГ контролировалась дифракционным методом. По данным этого метода, расстояние между примыкающими к интеркалату слоями углерода равно  $(7,79 \pm 0,01)$  Å. Измерения приращения веса пластинок до и после внедрения в них молекул азотной кислоты привели к формуле соединения  $C_{20-x}HNO_3$ . По этим характеристикам синтезированные соединения были отнесены к четвертой стадии  $\alpha$ -модификации ИСГ с  $HNO_3$ , представители которой описываются общей формулой  $C_{2n}HNO_3$  ( $n = 1, 2, 3, \dots$ ) [11, 17]. В этой модификации плоскости молекул  $HNO_3$  ориентированы практически перпендикулярно углеродным слоям [11].

Пластинки ИСГ помещались в запаянные кварцевые ампулы и при измерениях ориентировались таким образом, чтобы их ось  $c$  была перпендикулярна, а вертикальные грани параллельны  $\vec{H}_\eta$ . Образцы располагались в пучности  $\vec{H}_\eta$  (в геометрической середине резонатора).

Температурные исследования спектров ЭПР ЭП пластинок ИСГ проводились в интервале 200–300 К. Изменение температуры осуществлялось путем регулировки скорости и температуры потока газообразного азота, протекающего через кварцевый дьюар с образцом. В области  $T_c$  температура изменялась ступенчато с шагом  $\Delta T = 0,2$  град и поддерживалась с точностью 0,1 град/ч. Зависимость формы линий ЭПР ЭП от размеров пластинок ИСГ исследовалась при 300 и 220 К.

Значение  $\sigma_a$  синтезированных ИСГ определялось бесконтактным индукционным методом на установке, схема которой аналогична описанной в [18].

## ЭКСПЕРИМЕНТ

Во всем температурном интервале исследований от ИСГ  $C_{20}HNO_3$  наблюдается одиничный сигнал ЭПР ЭП с "нормальной" фазой формы линии, в том смысле, что более интенсивное крыло сигнала с пиковой интенсивностью  $A$  находится в меньших, чем менее интенсивное крыло интенсивностью  $B$ , магнитных полях. При данной температуре и  $I$  значения  $A/B$  и ширины линий ЭПР ЭП  $\Delta H$ , измеренной на полувысоте пика  $A$ , не зависят от  $h$ ,  $d$  и моды микроволнового поля и ориентации пластинки относительно  $H_0$ . Спектр аксиален относительно  $\epsilon$  и имеет независящие от температуры главные значения  $g$ -тензора:  $g_{\parallel} = 2.0023 \pm 0.0001$  и  $g_{\perp} = 2.0028 \pm 0.0001$ , определенных по процедуре Фехера и Кипа [14] или Кодера [15]. При  $H_0 \perp (II)c$  интегральные интенсивности сигнала, вычисленные по формуле  $I = (A + B)\Delta H^2$ , в обоих резонаторах относятся соответственно как 11:10. Заметим, что наличие слабой угловой зависимости значения  $I$  от ориентации пластины ИСГ относительно  $H_0$  и в цилиндрическом резонаторе означает, что ее причиной является взаимодействие электронной подсистемы ИСГ с  $H_0$ , а не с микроволновым полем.

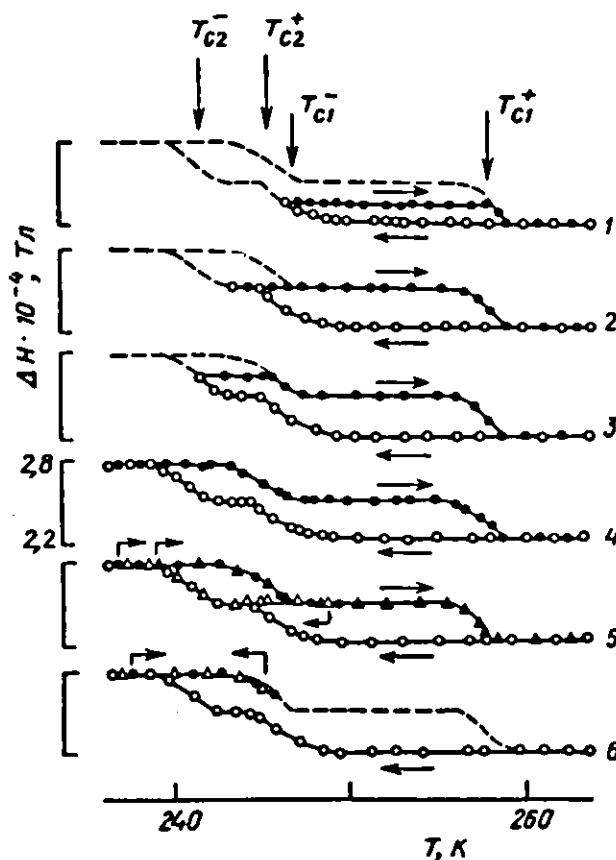


Рис. 1. Температурная зависимость ширины  $\Delta H$  линий ЭПР ЭП при кристаллизации (плавлении) интеркалатов в  $C_{20}HNO_3$ . Светлые (темные) фигуры отвечают экспериментальным значениям параметров при охлаждении (нагревании) ИСГ. Кривые 1–6 отвечают различным предельным температурам прохождения из жидкой в твердую фазу интеркалата;  $T_c^-(T_c^+)$  и  $T_{c2}^-(T_{c2}^+)$  – соответственно температура первого и второго ступенчатых изменений  $\Delta H$  при охлаждении (нагревании) образца. Стрелки указывают направления изменения температуры по соответствующим кривым;  $H_0 \perp c$ ,  $v = 9,52$  ГГц

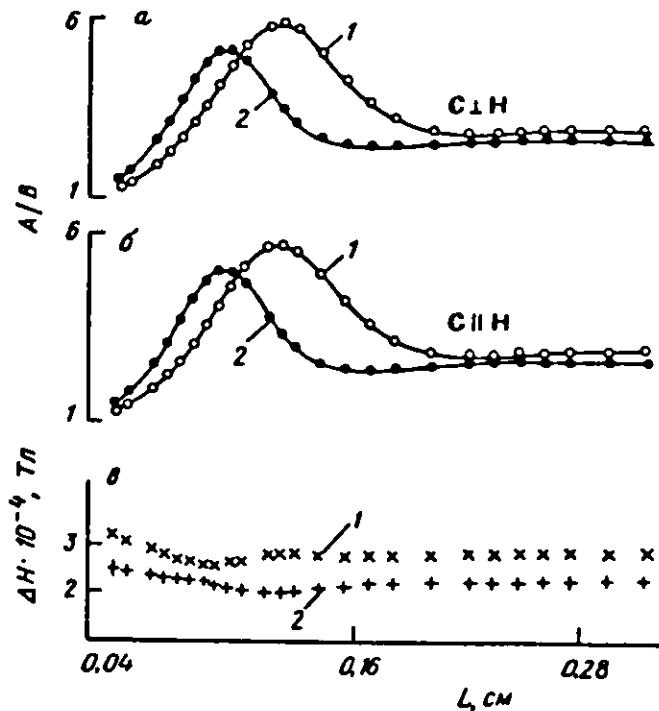


Рис. 2. Зависимость параметра асимметрии  $A/B$  (а, б) и ширины  $\Delta H$  (в) линии ЭПР ЭП пластинок ИСГ  $C_{20}HNO_3$  с размерами  $l \times 0.505 \times 0.018 \text{ см}^3$  от  $l$  при  $300 \text{ К}$  (1) и  $220 \text{ К}$  (2) и  $v = 9,52 \text{ ГГц}$ . Теоретические кривые при  $300$  ( $200$ ) К рассчитаны по уравнению формы линии Дайсона [12] с  $\sigma_c = 1,6$  ( $2,7$ )  $\text{Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ ,  $R_s = 1,2$  ( $1,8$ ) и  $T_2 = 2,84$  ( $2,13$ )  $\cdot 10^{-4} \text{ с}$

Значения  $A/B$  и  $\Delta H$  вплоть до  $250 \text{ К}$  не зависят от температуры и соответственно равны  $3,2 \pm 0,2$  и  $2,2 \text{ Гс}$ . При дальнейшем понижении температуры значение  $\Delta H$  двухступенчато растет (рис. 1). В области ступенчатого увеличения  $\Delta H$ , производная  $d(\Delta H)/dT$  имеет максимумы при  $T_{c1}^+ = (247 \pm 0,3) \text{ К}$  и  $T_{c2}^+ = (242 \pm 0,3) \text{ К}$ . При увеличении температуры  $\Delta H$  и  $A/B$  изменяются в обратной последовательности, однако с "глобальным" температурным гистерезисом. В частности, наиболее быстрое уменьшение  $\Delta H$  наблюдается при  $T_{c2}^+ = (245 \pm 0,3) \text{ К}$  и  $T_{c1}^+ = (258 \pm 0,3) \text{ К}$  (рис. 1). Независимо от направления изменения температуры переходы между различными участками кривой  $\Delta H(T)$  (ее "изломы") наблюдаются примерно при одном и том же значении (рис. 1). Наличие температурного гистерезиса областей ступенчатого изменения  $\Delta H(T)$  позволяет рассматривать эти изменения как обусловленные фазовыми переходами первого рода. Значение  $l$  при понижении температуры от  $300$  до  $220 \text{ К}$  увеличивается в  $\approx 1,4$  раза. Поскольку, согласно литературным данным [11, 17], в  $C_{5n}HNO_3$  температура кристаллизации (плавления) двумерных слоев интеркалата  $T_c = 250 \text{ К}$ , выявленные в  $C_{20}HNO_3$  при температурах, близких к указанной, изменения формы линии ЭПР ЭП в дальнейшем рассматривались как обусловленные изменением агрегатного состояния подсистемы "гостевых" молекул. При мощностях, далеких от насыщения, и одинаковой температуре значение  $\Delta H$  в  $Q$ -диапазоне на  $7\%$  больше, чем в  $X$ -диапазоне.

Зависимость  $A/B$  от  $l$  при  $300$  и  $220 \text{ К}$  имеет однопиковый вид, при  $l \rightarrow 0$  проходит через предшествующий максимум минимум, а при больших  $l$  выходит на "плато" (рис. 2, а, б). При  $T > (<) T_c$  – значения  $A/B$  в максимуме, достигаемом при  $l_{max} = 0,12(0,085) \text{ см}$ , в минимуме, достигаемом при  $l_{min} = 0,22(0,16) \text{ см}$  и на "плато",

достигаемом при  $l > 0,36$  ( $0,28$ ) см, соответственно равны:  $5,8 \pm 0,2$  ( $5,1 \pm 0,2$ ),  $2,9 \pm 0,2$  ( $2,5 \pm 0,2$ ) и  $3,2 \pm 0,2$  ( $2,8 \pm 0,2$ ). Зависимость  $\Delta H(l)$  в общих чертах повторяет вид зависимости  $A/B$  от  $l$ , однако при  $l \rightarrow 0$ , начиная с  $l > l_{\text{крит}}$ , наблюдается некоторое увеличение  $\Delta H$  (рис. 2, в), объяснимое трансформацией дайсоновской формы линий к лоренциальному.

Значение  $\sigma_s$  пластинок ИСГ  $\text{C}_{20}\text{HNO}_3$  при понижении температуры увеличивается от  $\approx 3,2 \cdot 10^5 \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$  при  $300 \text{ К}$  до  $\approx 4,1 \cdot 10^5 \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$  при  $200 \text{ К}$ .

## ОБСУЖДЕНИЕ

Уровень Ферми ИСГ с  $l > 1$  пересекает несколько зон [11, 19, 20]. Однако в шкале времени ЭПР из-за усреднения по поверхности Ферми различные состояния носителей тока в ИСГ неразличимы [1–11, 20]. Это позволяет рассматривать ИСГ  $\text{C}_{20}\text{HNO}_3$  в ЭПР-эксперименте как проводник с одним типом носителей тока.

В изотропных металлах с одним типом носителей тока, если средняя длина свободного пробега электронов намного меньше толщины скин-слоя  $\delta$  (так называемый "нормальный" скин-эффект), последний связан с проводимостью  $\sigma$  на частоте  $\nu$  известным соотношением  $\delta = c / (2\pi\sigma\nu)^{1/2}$ , где  $c$  – скорость света. Семейство кривых зависимости параметра асимметрии  $A/B$  линии ЭПР ЭП от приведенной к  $\delta$  толщины  $L$  металлической пластинки для различных значений отношения  $R = (T_0 / T_2)^{1/2}$  ( $T_0$  время диффузии носителей спина сквозь скин-слой  $\delta$ ,  $T_2$  – время спин-решеточной релаксации), вычисленное авторами для этого случая исходя из одномерного уравнения формы линии Дайсона для изотропных металлов  $F(\sigma, T_2, R, L)$  [12], представлено на рис. 3. В последующей интерпретации эксперимента интерес представляют только кривые с  $R > 0,55$ . Эти кривые имеют однопиковый вид зависимости  $A/B$  от  $L/\delta$  и при больших  $L/\delta$  выходят на "плато" с  $2,55 \leq A/B < 5$ . При  $L/\delta \rightarrow 0$  они проходят через предшествующий максимуму минимум. Номограммы, рассчитанные авторами по уравнению формы линии Дайсона [12] для определения при  $R > 0,55$  по значению  $A/B(L)$  в минимуме и в максимуме значения  $L/\delta$  соответствующего экстремума, по значению  $L/\delta$  экстремума значения  $R$  и по значению  $A/B(L)$  на "плато" значения  $R$ , представлены на рис. 4.

В прямоугольном резонаторе с модой  $TE_{102}$  при  $H_0 \parallel (\perp) \mathbf{c}$ , в допущении слабого возмущения образцом конфигурации и плотности силовых линий ненагруженного резонатора, Р перпендикулярен вертикальным граням  $h \times d$  ( $h \times l$ ) и микроволновое поле должно поглощаться только через эти грани. Очевидно, при справедливости сделанного допущения из-за большой анизотропии проводимости акцепторных ИСГ ( $\sim 10^5$  [11]) значения  $l$  и  $A/B$  резонансного сигнала должны сильно зависеть от ориентации пластинки относительно силовых линий микроволнового поля. Как уже отмечалось, в экспериментах с пластинками ИСГ  $\text{C}_{20}\text{HNO}_3$  такие зависимости не наблюдаются. Этот факт, а также совпадение форм линий ЭПР ЭП в прямоугольном и в цилиндрическом резонаторах указывают на то, что доминирующая роль в формировании микроволнового поля вблизи поверхности исследуемых пластинок ИСГ принадлежит им самим. Иными словами, в ргтг нет оснований считать  $\bar{H}_z$  вблизи вертикальных граней пластинок ИСГ однородным. Однако тем не менее в рассматриваемом случае отсутствие данных о характере распределения  $\bar{H}_z$  вблизи поверхности пластинок ИСГ не препятствует анализу их формы линии ЭПР ЭП. Действительно, отсутствие зависимости формы линии ЭПР ЭП от  $d$  и  $h$  и совпадение вида кривых  $A/B(l)$  и  $\Delta H(l)$  при  $H_0 \parallel (\perp) \mathbf{c}$  (рис. 2) указывают на то, что при всех  $l$  независимо от ориентации пластинок относительно  $H_0$  микроволновое поле поглощается ими преимущественно через вертикальные грани, параллельные  $\mathbf{c}$ . Или, иначе говоря, в исследуемых рядах пластинок ИСГ из-за пренебрежимо малого вклада в резонанс

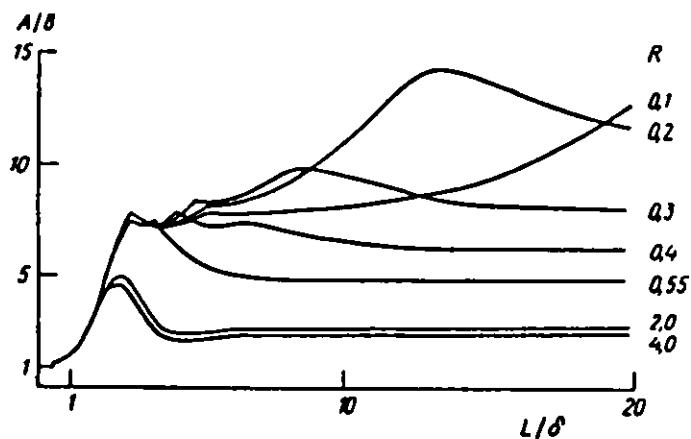


Рис. 3. Теоретические кривые зависимости параметра асимметрии  $A/B$  линии ЭПР подвижных носителей спина от приведенной к скрин-слою толщины пластинок  $L$  при различных значениях  $R = (T_D / T_2)^{1/2}$ , рассчитанные по уравнению формы линии Дайсона [12]

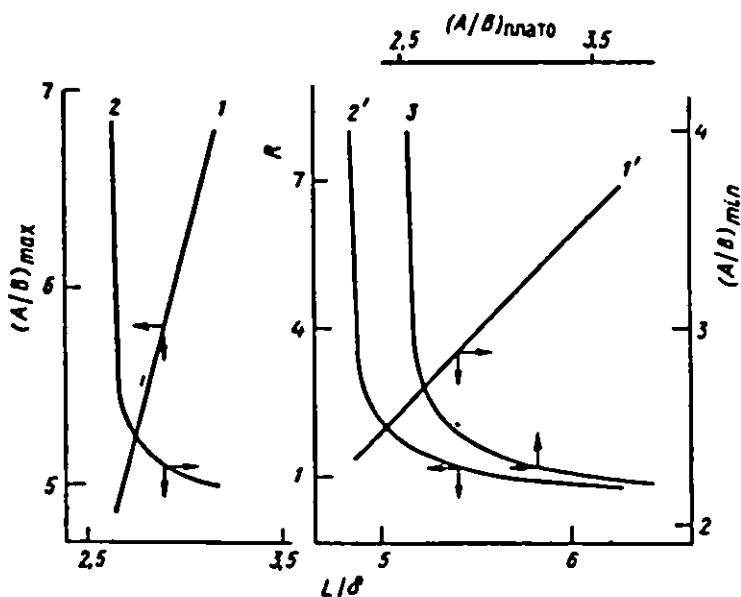


Рис. 4. Теоретические кривые для определения по значению параметра асимметрии  $A/B(L)$  в максимуме (минимуме) и кривой 1 (1') значения  $L/\delta$  экстремума; по значению  $L/\delta$  максимума (минимума) и кривой 2 (2') значения  $R$ ; по значению  $A/B(L)$  на "плато" и кривой 3 значения  $R$

областей, прилегающих к их базовым граням, характер распределения  $H_f$  вблизи вертикальных граней в пределах точности эксперимента не влияет на контур линии ЭПР ЭП. Поэтому для его описания можно использовать одномерное выражение Дайсона для формы линии ЭПР ЭП в изотропных металлах:  $F(\sigma_r, R_a, T_2, l)$  [12], где  $R_a = (T_{D_a} / T_2)^{1/2}$  ( $T_{D_a}$  – время диффузии носителей спина вдоль базовой плоскости сквозь скрин-слой  $\delta_a$ , определяемый проводимостью  $\sigma_r$ ).

Однопараметрическая зависимость  $A/B$  от  $l$ , выходящая при больших  $l$  на "плато" с  $A/B < 5$ , а при  $l \rightarrow 0$  проходящая через предшествующий максимум минимум (рис. 2, а), свидетельствует о том, что в  $C_{20}HNO_3$ , как до, так и после кристаллизации интеркалата  $R_a > 0.55$ . Поэтому значения  $\delta_a$  (и при известных  $V$  отвечающие им значе-

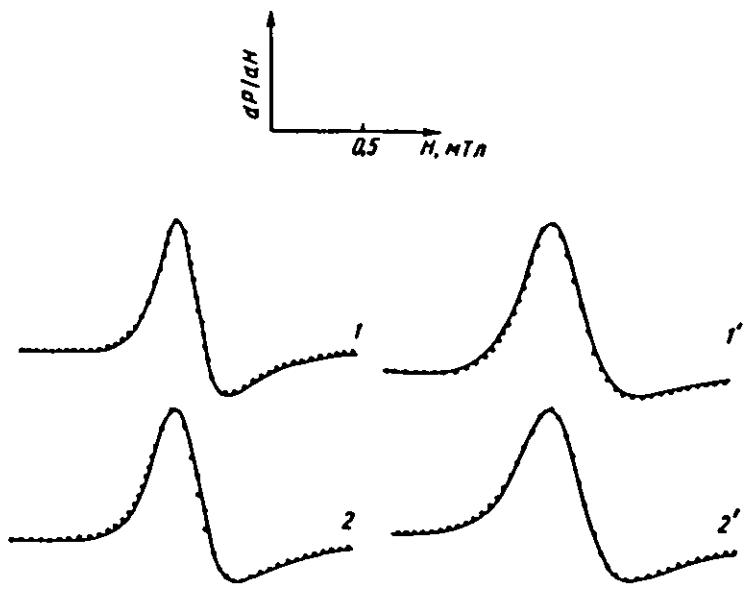


Рис. 5. Сравнение экспериментальных (сплошная линия) и теоретических (пунктирная линия) контуров первой производной ЭПР поглощения пластиноч ИСГ  $C_{20}HNO_3$ , с размерами  $l \times 0,505 \times 0,043 \text{ см}^3$  при  $I = 0,073$  ( $1,1'$ ) и  $0,294 \text{ см}$  ( $2,2'$ ) и  $T = 300$  ( $1,2$ ) и  $220 \text{ К}$  ( $1',2'$ );  $H_0 = 1 \text{ Тс}$ ;  $v = 9,52 \text{ ГГц}$ . Теоретические кривые при  $300$  ( $220$ ) К вычислены по уравнению формы линий Дайсона [12] с  $\sigma_c = 1,6$  ( $2,7$ )  $\Omega^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ ,  $R_s = 1,2$  ( $1,8$ ) и  $T_2 = 2,84$  ( $2,10$ )  $\cdot 10^{-8} \text{ с}$

ния  $\sigma_c$ ) и  $R_s$  определялись по номограммам, представленным на рис. 4 по экспериментальным значениям  $A/B$ , выбранным в максимуме или в минимуме зависимости  $A/B$  от  $I$ . Значение  $R_s$  можно также оценить по значению  $A/B$  на "плато" этой же зависимости. Все указанные варианты оценки значений искомых параметров при  $300$  ( $220$ ) К приводят к одним и тем же значениям:  $\sigma_c = 0,041$  ( $0,031$ ) см,  $\sigma_c = 1,6$  ( $2,7$ )  $\Omega^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$  и  $R_s = 1,2$  ( $1,8$ ). Значение  $T_2$  при  $300$  ( $220$ ) К, вычисленное из соотношения  $T_2 = (g_\perp \beta / \hbar) / \Delta H$ , где  $\beta$  – магнетон Бора,  $\Delta H$  – ширина линии ЭПР ЭП пластиноч ИСГ с  $I$  из области "плато" зависимости  $A/B$  от  $I$  равно  $2,84$  ( $2,10$ )  $\cdot 10^{-8}$  с. Отметим, что при  $300$  К значение  $\sigma_c$ , исследуемого ИСГ = в 4,5 раза меньше значения соответствующей компоненты проводимости ВОПГ [21, 22] и близко к известному из литературы значению  $\sigma_c$  пластиноч ИСГ  $C_5HNO_3$ , при этой же температуре ( $\approx 1,8 \text{ } \Omega^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$  [23]). Численное моделирование экспериментальных зависимостей  $A/B$  от  $I$  и контуров линий ЭПР ЭП пластиноч ИСГ  $C_{20}HNO_3$ , проведенное с использованием одномерного уравнения формы линии Дайсона  $F(\sigma_c, T_2, R_s, I)$  при подстановке в нее определенных выше значений  $\sigma_c$ ,  $T_2$  и  $R_s$ , приводит к хорошему соответствии между теоретическими и экспериментальными кривыми (рис. 2, а, б и рис. 5). Зная  $R_s$  и  $T_2$  при  $300$  ( $200$ ) К, по номограммам Фехера и Кипа [14] легко определить  $T_{Dc} = 2,09$  ( $9,52$ )  $\cdot 10^{-8}$  с. Согласно Дайсону [12], в приближении независимых электронов  $T_D$  связано с константой диффузии  $D$  носителей спина соотношением  $D = \delta^2 / 2T_D$ . В свою очередь подвижность  $\mu$  связана с  $D$  известным вторым соотношением Эйнштейна для процессов диффузии:  $\mu = eD/kT$ . По аналогии из этих соотношений можно вычислить константу диффузии  $D_s$  и подвижность  $\mu_s$  носителей спина вдоль слоев графита в  $C_{20}HNO_3$ . Результаты такого рода вычислений при  $300$  ( $220$ ) К приводят к значениям  $D_s = 2,06(7,1) \cdot 10^{-4} \text{ см}^2 \cdot \text{с}^{-1}$  и  $\mu_s = 6,9(3,7) \cdot 10^5 \text{ см}^2 \cdot (\text{В} \cdot \text{с})^{-1}$ . Как видим, при кристаллизации интеркалата  $\mu_s$  уменьшается при одновременном увеличении  $\sigma_c$ . Объяснение этому противоречию содержится в темпе-

ратурной зависимости  $I$ . Действительно, при данной геометрии образца  $I \propto N\delta$ , где  $N$  – концентрация носителей тока. Поэтому наблюдаемое в  $C_{20}HNO_3$  при кристаллизации интеркалата увеличение  $I$  при одновременном уменьшении  $\delta$ , однозначно указывает на происходящее при этом увеличение  $N$ .

В  $C_{20}HNO_3$  отсутствие частотной зависимости  $\Delta H$  как в квазижидкой, так и в твердой фазе интеркалата указывает на однородное уширение линии ЭПР ЭП этого соединения. Близость главных значений  $g$ -тензора носителей спина в исследуемых ИСГ к  $g$ -фактору свободного электрона и их неизменность при изменении агрегатного состояния интеркалата свидетельствуют о том, что плотность вероятности носителей спина на молекулах интеркалата мала и не изменяется при фазовом переходе. Этот результат свидетельствует в пользу возможности рассмотрения происходящих при фазовом переходе изменений электронных свойств  $C_{20}HNO_3$  в рамках модели жестких зон ИСГ [11, 19]. В рамках указанной модели в акцепторных ИСГ, относящихся к проводникам с дырочной поверхностью Ферми [11], увеличение  $N$  при понижении температуры возможно только при понижении уровня Ферми вследствие "изъятия" дополнительной электронной плотности у слоев графита [11, 24]. Иначе говоря, кристаллизация (плавление) решеточной жидкости в  $C_{20}HNO_3$  индуцирует в нем окислительную (восстановительную) реакцию. В ИСГ  $C_{5w}HNO_3$  отрицательный заряд в слое интеркалата представлен в виде фрагментов  $NO_3^-$ , окруженных нейтральными молекулами  $HNO_3$  [11, 25]. Поэтому одной из форм локализации заряда при кристаллизации интеркалата может быть увеличение концентрации  $NO_3^-$ . Поскольку локализованные заряды являются для электронов проводимости центрами рассеяния, увеличение  $N$ , очевидно, должно сопровождаться уменьшением  $\mu$  и увеличением  $\Delta H$ . Иными словами, модель жестких зон ИСГ качественно правильно предсказывает изменения  $\sigma$  и  $\Delta H$  при кристаллизации подсистемы "гостевых" молекул, что служит хорошим аргументом в пользу ее применимости для интерпретации экспериментальных данных.

Из вида зависимости  $\Delta H(T)$  в критической температурной области (рис. 1) следует, что двумерное плавление интеркалата реализуется через некоторое промежуточное состояние, т.е. является двухступенчатым процессом. Из-за отсутствия структурных данных в интервале существования этой "промежуточной" фазы ее идентификация затруднена. Тем не менее некоторые предположения о ее природе можно сделать. Действительно, из теории двумерного плавления известно [26], что в идеальных двумерных системах (при отсутствии потенциала подложки) переход из твердой фазы в жидкую происходит через промежуточную "гексатическую" фазу. "Гексатическая" фаза характеризуется наличием квазидальнего ориентационного упорядочения и отсутствием позиционного упорядочения [26]. При отсутствии влияния подложки переходы как из твердой фазы в "гексатическую" фазу, так и из последней в жидкую являются непрерывными, а при наличии взаимодействия с подложкой оба эти перехода могут совершаться скачкообразно [26]. В  $C_{5w}HNO_3$  в квазижидкой фазе интеркалата молекулы  $HNO_3$  врачаются относительно связи углерод – кислород [25, 27] и совершают трансляционные "прыжки" между позициями, задаваемыми периодическим кулоновским потенциалом прилегающих к интеркалату слоев графита [27]. В твердой фазе интеркалата оба указанных вида движений молекул  $HNO_3$  "заморожены" [27]. Опираясь на эти данные, можно высказать предположение, что выявленная в  $C_{20}HNO_3$  "промежуточная" фаза средин "гексатической" фазе, т.е. в этом состоянии молекулы интеркалата возможно уже совершают трансляционные "прыжки", но их вращения еще "заморожены".

Таким образом, экспериментальное обоснование возможности применения одномерной теории Дайсона [12] для анализа формы линии ЭПР ЭП пластинок квазидвумерного сильваннитронного синтетического проводника  $C_{20}HNO_3$  позволило определить значения некоторых кинетических параметров носителей спина и  $\sigma$ , и этом

составлении. В свою очередь анализ температурной зависимости последних позволил выявить ранее неизвестные аспекты двумерного плавления слоя интеркалата в кулононовском потенциале прилегающих к нему слоев углерода.

Авторы признательны В.В. Середе за модернизацию установки бесконтактного измерения электропроводности и Л.Б. Непомнящему (НИИ Графит) за предоставленные для синтеза ИСГ пластинки ВОПГ. Анализ и интерпретация изложенных в статье экспериментальных данных выполнены А.М. Зиатдиновым.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Muller K.A., Kleiner R. // Phys. Lett. 1962. V. 1. № 1. P. 98.
2. Khanna S.K., Falardeau E.R., Heeger A.J., Fischer J.E. // Sol. Stat. Comm. 1978. V. 25. № 12. P. 1059.
3. Lauginie P., Estrade H., Conard J. et al. // Physica. 1980. V. 99B. № 3. P. 514.
4. Davidov R., Milo O., Palchan I., Selig H. // Synth. Met. 1983. V. 8. № 1. P. 83.
5. Palchan I., Davidov D., Zevin V. et al. // Synth. Met. 1985. V. 12. № 5. P. 413.
6. Stein R.M., Walmsley L., Rettori C. // Phys. Rev. B. 1985. V. 32. № 6. P. 4134.
7. Зиатдинов А.М., Цветников А.К., Мищенко Н.М., Глаущенко В.Ю. // Хим. физика. 1989. Т. 8. № 12. С. 1680.
8. Saint-Jean M., McRae E. // Phys. Rev. B. 1991. V. 43. № 5. P. 3969.
9. Ziatdinov A.M., Mishchenko N.M., Nikolenko Yu.M. // Synth. Met. 1993. V. 59. № 2. P. 253.
10. Ziatdinov A.M. // Ferroelectrics (USA). 1994. V. 155. № 1-3. P. 383.
11. Dresselhaus M.S., Dresselhaus G. // Adv. Phys. 1981. V. 30. № 2. P. 139.
12. Dyson F.J. // Phys. Rev. 1955. V. 98. № 2. P. 349.
13. Kaplan J.I. // Phys. Rev. 1959. V. 115. № 3. P. 575.
14. Feher G., Kip A.F. // Phys. Rev. 1955. V. 98. № 2. P. 337.
15. Kodera H. // J. Phys. Soc. Jpn. 1970. V. 28. № 1. P. 89.
16. Pifer J.H., Magna R. // Phys. Rev. 1971. V. 3. № 3. P. 663.
17. Buttumly M.J., Parry G.S., Ubbelohde A.R. // Proc. R. Soc. London. 1964. V. A279. № 291. P. 291.
18. Pendrys L.A., Zeller C., Vogel F.L. // J. Mat. Sci. 1980. V. 15. № 11. P. 2103.
19. Leung S.Y., Dresselhaus G. // Phys. Rev. B. 1981. V. 24. № 5. P. 3490.
20. Sugihara K., Matsuhara K., Tsuzuki T. // J. Phys. Soc. Jap. 1984. V. 53. № 2. P. 795.
21. Fischer J.E., Fuerst C.D., Kim H.J. // J. Mat. Res. Soc. Symp. Proc. 1983. V. 20. P. 169.
22. Зиатдинов А.М., Мищенко Н.М. // ФТТ. 1987. Т. 29. № 9. С. 2849.
23. Ubbelohde A.R. // Proc. Roy. Soc. Lond. A. 1972. V. 321. № 3. P. 445.
24. Loughin S., Grayeski R., Fisher J.E. // J. Chem. Phys. 1978. V. 69. № 8. P. 3740.
25. Conard J., Fuzellier H., Vangelisti R. // Synth. Met. 1988. V. 23. № 2. P. 277.
26. Strandburg K.J. // Rev. Modern Phys. 1988. V. 60. № 1. P. 161.
27. Batallan F., Rosenman I., Magerl A., Fuzellier H. // Phys. Rev. B. 1985. V. 32. № 7. P. 4810.

Институт химии Дальневосточного отделения  
Российской академии наук  
Владивосток

Поступила в редакцию  
10.02.1994

Технический редактор Т.Н. Смолянникова

Сдано в набор 04.12.95 Подписано к печати 26.12.95 Формат бумаги 70 × 100 1/16  
Офсетная печать Усл. печ. л. 11.7 Усл. кр.-отт. 1.6 тыс. Уч.-изд. л. 13.7 Бум. л. 4.5  
Тираж 374 экз. Зак. 3700

Адрес редакции: 117977, ГСП, Москва, В-334, ул. Косыгина, 4. Тел. 939-74-95  
Институт химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской АН  
Московская типография № 2 РАН 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6